

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-90345

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成3年(1991)4月16日
B 32 B 9/00 7/02	1 0 3 1 0 4	9045-4 F 6804-4 F 6804-4 F		
15/08 17/06 C 03 C 17/42	D	7148-4 F 7148-4 F		
G 02 B 1/10	Z	8017—4 G 8106—2 H		

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全11頁)

**図発明の名称** 透明成形体

②特 願 平1-224650

20出 願 平1(1989)9月1日

@発	明	者	山	本	信	裚	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 中央研究所内	旭硝子株式会社
@発	明	者	米	田	貴	重	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地中央研究所内	旭硝子株式会社
@発	明	者	郡	司	文	明	神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地中央研究所内	旭硝子株式会社
⑦出 <b></b>	願理	人人	旭 A 弁理		株式会内田	社明	東京都千代田区丸の内2丁目1番2号	

明 細 書

1 , 発明の名称 透明成形体

## 2, 特許請求の範囲

- (1) 透明基材から成形されてなる成形体であって、該成形体の表面から空気側に向かって、表面抵抗値101°(Q/□)以下の高屈折率勝電層(A)、該(A) の屈折率と屈折率差が 0.1以上のフッ素化合物を含む低屈折率層(B)、の二層を設けてなる低反射性,導電性、防汚性、及び耐薬品性を有する透明成形体。
- (2) 透明基材がガラスである請求項 1 記載の透明成形体。
- (3) 透明基材がプラスチックである請求項1記載の透明成形体。
- (4) 高屈折率導電層(A) が酸化亜鉛、酸化錫、酸化インジウムから選ばれる少なくとも1種の無機微粒子を含むことを特徴とする請求項1記載の透明成形体。

- (5) 高屈折率導電層(A) が平均粒子径 1 ~ 300 nmの無機微粒子を含むことを特徴とする請求 項 1 または 4 記載の透明成形体。
- (6) フッ素化合物が下記式(C) または(D) を必 須成分として含有する組成物であることを特 数とする請求項1記載の透明成形体。

Rf', Rf\* はパーフルオロ基合有の有機基 R', R\* は水素または炭素数 1 から 6 の有機 基

a,b は独立に0,1,2 であって 0≤a+b ≤2 を 満たす。

c.d は独立に0,1,2 であって 0≤c+d ≤2 を満たす。

Y は 2 価の有機基。ただし、a+c=0 の場合にはパーフルオロ基を含有する 2 価の有機基。 X は加水分解可能な有機基

Rf\* はパーフルオロ基合有の有機基 R\* は水素または炭素数 1 から 6 の有機基 e は 1.2 であって g は 0.1.2 であって 0≤e+g ≤ 2 を満たす。

Xは加水分解可能な有機基

- (7) 透明基材から成形されてなる成形体がガラスより成形されてなるディスプレイ表示体である請求項1記載の透明成形体。
- 3, 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は、低反射性、導電性、防汚性及び耐薬品性を有する透明成形体に関し、更に詳しくは、低反射性により反射光による不快感、まなしさが低減され、かつ導電性を有することにより表面での静電気の蓄積、ほこりの吸着などを防ぐ効果を有し、しかもフッ素化合物による撥水撥油作用で指紋などの汚れが取れ易く、酸や

たこれらの膜は、酸、アルカリ等に弱く、耐薬 品性に劣るという欠点を併せもっていた。

#### [発明が解決しようとする課題]

本発明は、かかる現状に鑑みてなされたものであり、したがってその目的は従来技術の有していた問題点を解消し、反射防止性と帯電防止性とを具備し、しかも防汚性、耐薬品性を有する透明成形体を提供することにある。

## [課題を解決するための手段]

即ち、本発明は、透明基材から成形されてなる成形体であって、該成形体の表面から空気側に向かって、表面抵抗値10'°(Ω/□)以下の高屈折率導電層(A),該(A)の屈折率と屈折率差が0.1以上のフッ素化合物を含む低屈折率層(B)、の2層を設けてなる低反射性、導電性、防汚性及び耐薬品性を有する透明成形体を提供するものである。

本発明は、高屈折率導電層(A) および低屈折率層(B) の 2 層の屈折率及び膜厚を調節して光の干渉作用を利用することにより、目的の一つ

アルカリなどによる腐食を受けにくい透明成形体に関するものであり、CRTのパネル部及び前面板、タッチパネル、ショーケース、メーターカバーなど各種ディスプレイ表示体として好適に用い得るものである。

## [従来の技術]

テレビ受像機のCRT等においては、外部光の反射によって画像が見にくくなったり、動作中の帯電によって人体などとの間で放電が発生したり、ホコリ等のゴミが付着したりするのを防止するために、導電性反射防止膜が用いられている。

このような導電性反射防止膜を形成させた透明成形体の例としては、実開昭 59-168951号公報記載の酸化錫または酸化インジウムの導電膜の上に酸化珪素の膜を形成した陰極線管等が成した陰極線管等が成した陰極線である。これらは表面のノングレア処理にいるべて優れた解像度、反射防止特性を有していたの汚れが目立つという欠点をもっていた。ま

である低反射性が発現され、導電性を有する材料を含有する層を設けることによって、もう一つの目的である導電性が発現され、更に空気側の低屈折率層にフッ素化合物を含有させることにより、他の二つの目的である防汚性と耐薬品性を発現させようとするものである。

ンジウムなどが挙げられ、これらの少な高間間ののできる種の化合物がドープされていて をも間間の いっことは勿なる。 これが平均に (A) のないのは (A) のないのは

一方の低屈折率層(B)の低屈折率材料も各種の化合物が知られているが、本発明におけるる低屈折率材料は高屈折率層(A)の屈折率に比して低屈折率を与え、提水撥油性に優れたフッ素化合物を含む材料から選択する。高屈折率導電層(A)と低屈折率層(B)の屈折率差は、原理的には(空気側第1層の屈折率)く(空気側第2層の屈折率)であれば良いが、優れた低反射性を

Rf° はパーフルオロ基合有の有機基
R° は水素または炭素数 1 から 6 の有機基
e は 1,2 であって g は 0,1,2 であって
0 ≤ e+g ≤ 2 を満たす。

Xは加水分解可能な有機基

以下、構成要素について詳細に記述する。

本発明の組成物において(C) または(D) 成分は 防汚性、撥水性を発現するのに必須な成分であ る。

(C) 成分として例えば

X.SiC.H.CF(CF.),CFC.H.SiX.

X2SiC2H4CF(CF2),CFC2H4SiX2 R CF2 CF3 R

X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX.

X SiC H CF (CF 2) CFC H SiX a

発現するには両層の屈折率の差が 0.1以上であることが必要である。フッ素化合物は低屈折率材料として知られており、この目的にかなう材料である。本発明のフッ素化合物としては下記式(C) または(D) を必須成分として含有する組成物が、優れた撥水性、撥油性、耐薬品性を有する点で好ましい。

Rf¹,Rfª はパーフルオロ基含有の有機基 R¹,Rª は水素または炭素数 1 から 6 の有機基 a,b は独立に 0,1,2 であって 0≤a+b ≤ 2 を 満たす。

c.d は独立に 0,1,2 であって 0≤c+d ≤2 を 満たす。

Y は 2 価の有機基。ただし、a+c=0 の場合には パーフルオロ基を含有する 2 価の有機基。

Xは加水分解可能な有機基

X2SiC2H4CF(CF2)aCFC2H4SiX2 R C2Fa C2Fa R

X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX. C.F. C.F. R

X.SiC.H.CFCF.(CF.),CFC.H.SIX. CF. CF.

XaSiCaHaCFCFa(CFa)aCFCaHaSiXa R CFa CFa R

X.SiC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX. CF. CF. R

X.SiC.H.CFCF.O(CF.).OCF.CFC.H.SiX.

X = SiC = H - CFCF = O (CF = ) = OCF = CFC = H - SiX = R CF = R

X.SiC.2H.CFCF2O(CF2).OCF3CFC2H.SiX.

X.SiC.H. (CF.) nC.H.SiX.

X2SiC2H4 (CF2) nC2H4SiX2

X.SiC.H.(CF.).C.H.SiX.

X.SiC.H.CF(CF.) CFC.H.SiX. Rf CF. CF. Rf

Ŗf Ŗ f X-SiC.H.CF(CF.) CFC.H.SiX X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX. X=SiC+H+CF(CF+) = CFC+H+SiX+ Rf C+F+ C+F+ Rf X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX X-SiC.H.CF(CF.),CFC.H.SiX X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX. C.F. C.F. Rf X.SiC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX. CF. CF. X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX. X-SiC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX X.SIC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX. X.SiC.H.CFCF.O(CF.).OCF.CFC.H.SiX. X.SiC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX R CF. CF. R X-SiC\_H\_CFCF\_O(CF\_) OCF\_CFC\_H\_SiX X.SiC.H.CFCF.O(CF.).OCF.CFC.2H.SiX. X2SiCaH4 (CF2) nC2H4SiX2 X = SiC = H + CFCF = O (CF = ) = OCF = CFC = H + SiX R CF = CF = R X-\$iC.H. (CF.) .C.H.\$iX X.SiC.H. (CF.) C.H. SiX. X.SiC.H.CFCF.O(CF.)nOCF.CFC.H.SiX X = SiC = H 4 (CF = ) = C = H 4 SiX X.SiC.H.CFCF.O(CF.).OCF.CFC.H.SiX. R CF. CF. X-SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SIX. R CF. CF. X . S i C . H . (CF .) , C . H . \$ i X X.SiC.H.CF(CF.).CFC.H.SiX. R CF. CF. X = SiC = H + (CF = ) = C = H + SiX = X.SiC.H.SiX. Rf Rf X.SiC.H.CF(CF.),CFC.H.SiX. C.F. C.F. Rf X.ŞiC.H.SiX. X2ŞiC2H4ÇF(CF2),ÇFC2H4SiX X-\$icaH.SiX. X.SiC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX CF. CF. R X-SiC.H.SiX. X.SiC.H.CFCF.(CF.).CFC.H.SiX. CF. CF. X.SiC.H.SiX.

(RfCaH4) aSiXa

RfCONHC.H.SiX.
RfCONHC.H.SiX.

Recontcatantcatasixa Recontcatantcatasixa

RfCO<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CONH(CH<sub>3</sub>)SiX<sub>3</sub> RfCO<sub>2</sub>N(CH<sub>3</sub>)C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>CONH(CH<sub>3</sub>)SiX<sub>2</sub>

RfC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OCO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>SiX<sub>3</sub> RfC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OCO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>SiX<sub>2</sub>

RfC.H.OCONH(CH.).SiX.
RfC.H.OCONH(CH.).SiX.

RfC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>NH(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiX<sub>3</sub> RfC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>NH(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiX<sub>2</sub>

CF. CF. CF. CF.

CF.C.F.O(CFCF.O) CFCONH(CH.).SiX.

本発明の透明成形体をコーティング組成物の空布法で得るには単に高屈折率値電材料、あるいは低屈折率材料が溶解あるいは分散したコーティング組成物を透明基材に塗布すれば良いが、かかる場合の組成物の調製に際し、無機を立口イド状のものであっても何ら問はない。また組成物は塗布に好適となすために、

Rfは炭素数 1 ~16のパーフルオロアルキル基 n は 1 ~16の整数

ョ は1以上の整数

X は C1 , OCH。, OC . H。 等の加水分解可能な基 等がある。

(C) または(D) 成分の添加量は目的に応じて任意にすることが可能である。

本発明の組成物は(C) または(D) 成分のどちらか一方成分が必須であるが、もちろん両成分が含有されていても問題は無い。

- (C) または/及び(D) 成分はそのまま或は部分加水分解を行なって使用するが、加水分解にあたっては、単純に水を添加してもよいし、塩酸、酢酸、燐酸、硝酸、硫酸、スルホン酸等の酸性水溶液を添加してもよい。
- (C),(D) 成分に目的に応じて他の成分、添加剤を加えることは一向に差し支えがなく、他の成分、添加剤を加えることでこの組成物の適用範囲が大きくひろがることにつながる。

本発明において、優れた性能を有する高屈折 事事電層 (A) 及び低屈折率層 (B) を形成さに は造膜性も重要な要因の一つである。従っては コーティング組成物の塗布法においては、造膜 性を高めるために樹脂あるいは無機微粒で、 きにはそれらを含む組成物に他の成分をあずる ることができる。かかる他の成分として好って ものはシリコン化合物が挙げられ、シリコン

合物の添加は形成される被膜層の耐擦傷性を損 なうことがないという点で良好な添加成分であ る。シリコン化合物としては、メチルシリケー ト, エチルシリケート, n-プロピルシリケー ト、i-プロピルシリケート、n-ブチルシリケー ト、sec-ブチルシリケートおよびt-ブチルシリ ケートなどのテトラアルコキシシラン、および その加水分解物さらにはメチルトリメトキシシ ラン, メチルトリエトキシシラン, メチルトリ アセトキシシラン。メチルトリプトキシシラ ン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエ トキシシラン, ビニルトリメトキシシラン, ビ ニルトリエトキシシラン、ピニルトリアセトキ シシラン,フェニルトリメトキシシラン,フェ ニルトリエトキシシラン, フェニルトリアセト キシシラン, ャークロロプロピルトリメトキシ シラン、ァークロロプロピルトリエトキシシラ ン,ァークロロプロピルトリアセトキシシラ ン, 3,3,3-トリフロロプロピルトリメトキシシ ラン, γ-メタクリルオキシプロピルトリメト

キシプロピルトリエトキシシラン, ァーグリシ ドキシプロピルトリプロポキシシラン, ァーグ リシドキシプロピルトリプトキシシラン. ァー グリシドキシブロピルトリメトキシエトキシシ ラン, ァーグリシドキシプロピルトリフェノキ シシラン, α-グリシドキシブチルトリメトキ シシラン, α-グリシドキシブチルトリエトキ シシラン、β-グリシドキシブチルトリメトキ シシラン、β-グリシドキシブチルトリエトキ シシラン, ァーグリシドキシブチルトリメトキ シシラン、ャーグリシドキシブチルトリエトキ シシラン、δ-グリシドキシブチルトリメトギ シシラン, δ-グリシドキシブチルトリエトキ シシラン、(3,4-エポキシシクロヘキシル) メ チルトリメトキシシラン、 (3,4-エポキシシク ロヘキシル) メチルトリエトキシシラン。β-(3.4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメ トキシシラン、β- (3,4-エポキシシクロヘキ シル) エチルトリエトキシシラン, β - (3.4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリプロポキ

キシシラン, ァーアミノプロピルトリメトキシ シラン、ァーアミノプロピルトリエトキシシラ ン、ァーメルカプトプロピルトリメトキシシラ ン・アーメルカプトプロピルトリエトキシシラ  $\nu$ ,  $N-\beta-(P \in J \perp + \mu) - \gamma - P \in J \rightarrow J$ ロピルトリメトキシシラン, β-シアノエチル トリエトキシシラン,メチルトリフェノキシシ ラン、クロロメチルトリメトキシシラン、クロ ロメチルトリエトキシシラン、グリシドキシメ チルトリメトキシシラン、グリシドキシメチル トリエトキシシラン, α-グリシドキシエチル トリメトキシシラン, α-グリシドキシエチル トリエトキシシラン, β-グリシドキシエチル トリメトキシシラン、β-グリシドキシエチル トリエトキシシラン。α-グリシドキシブロビ ルトリメトキシシラン, α-グリシドキシプロ ピルトリエトキシシラン, β-グリシドキシブ ロピルトリメトキシシラン、βーグリシドキシ プロピルトリエトキシシラン, ァーグリシドキ シプロピルトリメトキシシラン, ァーグリシド

シシラン, β - (3,4-エポキシシクロヘキシ ル) エチルトリプトキシシラン, β - (3,4-エ ポキシシクロヘキシル) エチルトリフェノキシ シラン, ァー (3,4-エポキシシクロヘキシル) プロピルトリメトキシシラン, ァー (3,4-エポ キシシクロヘキシル) プロピルトリエトキシシ  $\ni \lambda$ ,  $\delta - (3, 4-x + 2) \rightarrow 0$ チルトリメトキシシラン, δ - (3,4-エポキシ シクロヘキシル) ブチルトリエトキシシランな どのトリアルコキシシラン, トリアシルオキシ シランまたはトリフェノキシシラン類または その加水分解物およびジメチルジメトキシシラ ン、フェニルメチルジメトキシシラン、ジメチ ルジエトキシシラン、フェニルメチルジエトキ シシラン, ァークロロプロピルメチルジメトキ シシラン, ァークロロプロピルメチルジエトキ シシラン, ジメチルジアセトキシシラン、ャー メタクリルオキシプロピルメチルジメトキシシ ラン, ァーメタクリルオキシプロピルメチルジ エトキシシラン. ァーメルカプトプロピルメチ

ルジメトキシシラン, ャーメルカプトプロピル メチルジエトキシシラン, ャーアミノプロピル メチルジメトキシシラン, ャーアミノプロピル メチルジエトキシシラン、メチルピニルジメト キシシラン、メチルピニルジエトキシシラン、 グリシドキシメチルメチルジメトキシシラン. グリシドキシメチルメチルジエトキシシラン. αーグリシドキシエチルメチルジメトキシシラ ン, α-グリシドキシエチルメチルジエトキシ シラン、β-グリシドキシエチルメチルジメト キシシラン、β-グリシドキシエチルメチルジ エトキシシラン, α-グリシドキシプロピルメ チルジメトキシシラン, α-グリシドキシブロ ピルメチルジエトキシシラン, β-グリシドキ シプロピルメチルジメトキシシラン、β-グリ シドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 ャーグリシドキシプロピルメチルジメトキシシ ラン. ァーグリシドキシプロピルメチルジエト キシシラン, ァーグリシドキシプロピルメチル ジプロポキシシラン, ァーグリシドキシプロピ

また、樹脂としては目的に応じて、溶解性、相溶性、分子量(分布、重合度)、含有する遺形を考慮して最適なものを選択できる。さらに、レベリング性を高めるために界面活性剤等を加えたり、形成される被膜層を改質し得る他の添加剤、紫外線吸収剤、滑剤等を加えてもよい。

本発明における透明成形体は透明基材から成形されてなるが、 透明基材としてはガラスおよびプラスチックであり、 ガラスとしては普通板

上記例示のシリコン化合物は1種あるいは数 種の混合物をそのままあるいは加水分解しては、単に純水の添加 良いが、酸の存在下で水を加えてもよい。酸 しては、塩酸、硫酸、酢酸、スルホン酸 等が用いられる。さらに形成される被膜層の耐 擦傷性を高めるために従来から公知の硬化触媒 等を加えることもできる。

ガラスはもとより、各種加工硝子、特にディスプレイ表示体としてブラウン管のパネル部などが好適である。

また、プラスチックはその材質として、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリジェチレングリコールピスアリルカーボネート、ポリスチレン、ポリ塩化ピニル、ポリウレタン、不飽和ポリエステル等が挙げられる。

#### [実施例]

以下に実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

実施例において得られた透明成形体の評価方法については次の通りである。

## (1) 低反射姓の評価

GAMMA分光反射スペクトル測定機により 基材表面の片面の視感反射率を測定。

## (2) 導電姓の評価

ハイレスタ抵抗測定器(三菱油化製)により

基材の表面抵抗値を測定。

(3) 防汚性の評価

A. ヘキサデカンの接触角を測定した。

B. 手の指紋を処理表面に付着後、綿布で20 往復拭き取りその後の外観を検査し、以 下の基準で評価した。

A: 完全にきれいに油汚れが拭き取れる。

B:少し油汚れが残る。

C:かなり油汚れが残る。

(4) 撥水性の評価

A. 水の接触角を測定した。

B・サンプルから 20cm の距離に保持したノ ズルから水道水をスプレーして試験し た。適当な時間、水のスプレーをテスト サンプルの処理表面に当てた後スプレー を止め、サンプルに残った水滴を肉眼で 検査し以下の評価基準で判断した。

A: サンプル表面に全く水滴が残らない。

B: サンプル表面に少し水滴が残る。

C: サンプル表面にかなり水滴が残る。

[低屈折率層用コーティング組成物(U液)の 調製]

下記A成分を19.0g、B成分を5.0g、S成分を5.6g、撹拌子がセットされた三つ口に入れ混合した。更にイソプロピルアルコール、2-メチル-2-プロパノールを各々600g、1400g加えた。次にアルミニウムアセチルアセトナート2.2gを加えよく撹拌した。これに1% HC1水溶液6.7gを徐々に滴下した。滴下終了後25℃に保温し7日間放置した。(以下、U-1液と略)

A : (CH.0) .SiC.H.C.F..C.H.Si(OCH.).

B : C.F. . C. H. Si (OCH.) .

S : Si(OCH.).

予め洗浄されたガラス板 [10 cm×10 cm (厚さ3 mm)] を T - 1 液に浸漬した。浸漬後、10 cm/min の速さで引き上げ、100 ℃、10 分焼成した。次に、このガラス板を U - 1 液に浸漬後、5 cm/min の速さで引き上げ、200 ℃、60分焼成した。このようにして、2 層の被膜層の形成されたガラス板を得た。このガラス板につ

D: サンプル表面に水が濡れ広がる。

(5) 耐療傷性、耐久性の評価

1 kgの荷重下に消しゴムで基材表面を 100往 復後、その表面の傷の付き方を調査。

耐擦傷性の評価の基準は以下の通り

A: 傷が全くつかない。

B: 傷が少しつく。

C: 多くの傷がつく。

また、耐久性として、上記の耐擦傷性評価後、低反射性、導電性、防汚性、撥水性を評価。 実施例 1

[高屈折率導電層用コーティング組成物 (T液)の調製]

テトラエトキシシラン 50g をエタノール 200g に溶解した。次にこれに、1 %塩酸水溶液 46g を徐々に滴下し、3 日間熟成して部分加水分解物を得た。これに 200gのエタノール分散アンチモンドープ酸化錫ゾル液(濃度 3%、平均粒子径 100nm )を加えて調製した。(以下、T-1 液と略)

いて前記の評価方法に従って評価し、その結果を第1表に示す。

比較例1

比較例として、実施例1に用いたガラス板について被膜層を形成することなく評価し、その結果を第1表に示す。

実施例2

実施例1におけるガラス板をテレビ用ブラウン管のパネル部に変えた他は同様にして、表面に2層の被膜層を形成した。このようにして得られたパネルについて評価し、その結果を第1表に示す。

			ĸ	<b>₹</b>	,						
	報	教面抵抗值	接触角(*)	( )	49.154	40 4.00	五社会/加		耐久	##	
Ę	(%) (%)	(D/a)	41	*	TL CKIN	が大は	T T	初島	数面抵抗值	机污性	都大柱
			カイング					(%)	(Pa)		
東路型	0.4	6.6×10*	74	118	٧	٧	<	0.5	6.7×10*	∢	<
,2	0.3	6.8×10*	75	116	٧	٧	<	9.4	7.0×10*	٧	۷
33	0.4	5.8×10*	74	109	٧	٧	∢	0.4	5.9×10°	V	۷
* 4	0.4	5.0×10°	69	115	٧	4	∢	0.5	5.2×10*	4	<
比較別 1	1.8	測定不能	6	21	ນ	Ω	<	i	!	;	l
, 2	2.3	湖定不能	21	22	C	Ω	٧		i	1	!

## 実施例5~11、比較例3~4

実施例1に用いたU-1液のA成分、B成分、S成分に変えて、第2表に示した種類の化合物及び量だけ用いて組成物を調合し、他は実施例1と同様にして2層の被膜層の形成されたガラス板を得た。

第 2 表

S20140/15	oht.		成分及び成分比(g)											
実施例	ijno.	Α	В	X1	X2	X3	X4	X5						
	5	19.0	5.0	6.8										
١	6	19.0	5.0		5.9									
l	7	19.0	5.0			7.4		·						
1	8	19.0	5.0				2.2							
i	9	19.0	5.0					0.2						
	10	24.0		4.5				1						
	11		24.0	4.5		ŀ		l						
比較例	3			5.8	20.0		1	1						
	4	j	1	5.8	10.0	10.0								

X1=テトラメトキシシラン

X2=γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン

X3=ジメチルジメトキシシラン

X4=イソプロピルアルコール分散コロイダルシリカ

X5=イエポキシ樹脂油化シェル社製 EP827

このガラス板について評価し、その結果を第3 表に示す。

#### 比較例 2

比較例として、実施例2にて用いたテレビ用 ブラウン管のパネル部について被膜層を形成す ることなく評価し、その結果を第1表に示す。 実施例3~4

実施例1に用いたU-1液に変えて下表のU 液を用いた他は実施例1と同様にして2層の被 膜層の形成されたガラス板を得た。

実施例	U 液
3	U-1液のA成分19.0gを下記のA1成分16.4gに変えた。
4	U - 1 液の B 成分 5.6gを下記の B 1 成分 4.9gに変えた。

A 1 : (CH<sub>2</sub>O)<sub>2</sub>SiC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>C<sub>6</sub>F<sub>1</sub><sub>2</sub>C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Si(OCH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>
CH<sub>2</sub>
CH<sub>3</sub>

B 1 : C.F. C.H.Si(OCH.) 2 C.H.

このガラス板について評価し、その結果を第 1 表に示す。

## 宴施例12~16

実施例1におけるT-1液に変えて下表のT液(高屈折率導電層用コーティング組成物)を用い、U-1液塗布後の焼成温度を 200℃から400 ℃に変えたほかは実施例1と同様にして、2層の被膜層の形成されたガラス板を得た。

実 施 例	T 液
1 2	T-1液のアンチモンドープ酸化 錫ゾル液を錫ドープ酸化インジウム粉末分散液(エタノール、 3%) 200gに変えた。
1 3	T-1液のアンチモンドーブ酸化 錫ゾル液を亜鉛アセテルアセトネート塩溶液(エタノール、3%) 200 gに変えた。
1 4	T-1液のアンチモンドープ酸化 錫ゾル液を錫アセテルアセトネート塩溶液(エタノール、3%) 200 gに変えた。
1 5	T-1液の珪酸エチル50gをメチルトリメトキシシラン45gに変えた。
1 6	T-1液の珪酸エチル50gをィーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン36gに変えた。

このガラス板について評価し、その結果を第3 表に示す。

		都大群		¥	4	<	٧	4	4	A	٧	A	¥	A	٧	В	В
	世	数元性		*	V	٧	A	4	4	Y	A	٧	V	٧	V	В	В
	耐久	表面抵抗值	P g	6.7×10	6.6×10*	7.0×10	6.2×10	6.9×10	6.4×10*	6.6×10	1.1×10°	6.5×10*	6.5×10*	6.0×10	4.2×10	6.6×10*	6.2×10*
		調率	8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.8	1.0	0.5	0.7	1.2	1.3
	X 445/4	EAT F		٧	A	٧	٧	٧	٧	٧	٧	Y	А	٧	٧	٧	٧
	10			٧	٧	٧	٧	٧	٧	Α	٧	Α	٧	A	¥	В	В
聚	北北	またが		∢	Y	A	Α	٧	A	A	٨	٧	Α	٧	٧	၁	၁
無3条	( ,) b	*		108	105	111	109	100	87	117	117	120	118	116	114	72	74
\$4X	捻帕	かずか	が	67	99	29	71	59	33	71	74	75	76	72	74	22	82
	表面抵抗值	(D/a)		6.6×10	6.4×10	6.9×10	6.0×10°	6.8×10*	6.2×10*	6.5×10*	4.0×10	5.4×10*	6.0×10*	4.0×10*	3.0×10	6.4×10*	6.0×10*
	福	<b>3</b>		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.4	9.0	1.0	=
	ź	!	į	<b>医</b> 20	9 "	1 1	% %	6 "	/ 10	" 11	// 12	// 13	// 14	<i>"</i> 15	<i>"</i> 16	比較到	" 4

## [発明の効果]

本発明の透明形成体は

- ① 優れた導電性を有することから、静電作用 によるホコリの付着を防ぐ。
- ② 優れた低反射性を有することから、反射光 による不快感、まぷしさが低減される。
- ③ 優れた防汚性を有することから、汚れが付着しにくく、たとえ汚れが付着しても布や ティッシュペーパーで簡単に拭き取ることが できる。
- ④ 優れた耐薬品性を有することから、酸やアルカリによる腐食を受けにくい。
- ⑤ 優れた耐擦傷性を有し、しかも耐久性も良好である。
- ® 数多くの材料の選択が可能であり、性能の 幅を広く設定できる。

という特徴がある。

#### 実施例17

実施例1で得られた2層の被膜層の形成されたガラス板を第4表に示す薬品に24時間浸漬した。浸漬後洗浄を行い、低反射性、導電性、防汚性、撥水性を評価した。結果を同じく第4表に示す。

第 4 表

試 薬	外観	視感 反射率 (%)	表面反射率 (Q/口)	防汚性	撥水性
メタノール	変化なし	0.4	6.7×10°	Α	Α
アセトン	変化なし	0.4	6.8×10°	A	Α
3%硫酸水溶液	変化なし	0.4	6.4×10*	A	Α
トルエン	変化なし	0.4	7.2×10°	Α	Α
3%水酸化ナトリウム水溶液	変化なし	0.5	6.4×10°	Α	Α
水	変化なし	0.4	6.5×10°	Α	Α
2ープロパノール	変化なし	0.4	6.8×10°	Α	Α
市販洗剤、漂白剤	変化なし	0.4	6.4×10°	Α	Α
15%アンモニア 水溶液	変化なし	0.4	6.4×10°	A	Α
四塩化炭素	変化なし	0.4	7.0×10°	Α	Α
ガソリン	変化なし	0.4	7.3×10°	Α	Α